

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2024/036983 A1

(43) 国际公布日
2024 年 2 月 22 日 (22.02.2024)

- (51) 国际专利分类号:
B24B 37/24 (2012.01) *G01N 30/02* (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2023/086148
- (22) 国际申请日: 2023 年 4 月 4 日 (04.04.2023)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202210978288.4 2022 年 8 月 16 日 (16.08.2022) CN
- (71) 申请人: 湖北鼎汇微电子材料有限公司 (HUBEI DINGHUI MICROELECTRONICS MATERIALS CO., LTD) [CN/CN]; 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。湖北鼎龙控股股份有限公司 (HUBEI DINGLONG CO., LTD.) [CN/CN]; 中国湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号, Hubei 430057 (CN)。

- (72) 发明人: 罗乙杰 (LUO, Yijie); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。陈博 (CHEN, Bo); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。张季平 (ZHANG, Jiping); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。高越 (GAO, Yue); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。刘敏 (LIU, Min); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。蔡龙丹 (CAI, Longdan); 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房, Hubei 430057 (CN)。
- (74) 代理人: 北京派特恩知识产权代理有限公司 (CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE); 中国北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦南座五层 503, Beijing 100080 (CN)。
- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 发明名称: 一种抛光垫

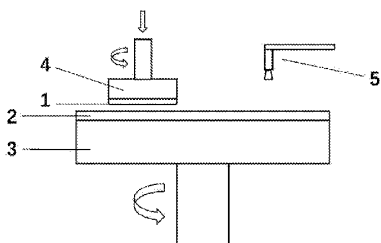


图 1

(57) Abstract: A polishing pad (2), comprising a polishing layer (20). The polishing layer (20) comprises a polyurethane substrate, and the polyurethane substrate is obtained by reacting a polyfunctional isocyanate, a polyol composition and a polyamine composition. The polyamine composition comprises one and/or more diamines and/or ternary amines and/or polyamines having more than three elements, the average molecular weight of the polyamine composition is between 200 and 400, the average functionality of the polyamine composition is greater than 2 and does not exceed 2.20, and the ratios of the diamines and the ternary amines in the polyamine composition to the total amount of the polyamine composition are 77%-96%: 3%-12%. The polishing pad has high controllability, relatively low processing condition requirements and a relatively wide processing window, and the formed polishing layer has relatively high service life stability. Further provided are a polyamine composition and a polishing layer.

(57) 摘要: 一种抛光垫 (2), 包含有抛光层 (20), 抛光层 (20) 包含聚氨酯基材, 聚氨酯基材由多官能异氰酸酯, 多元醇组合物以及多元胺组合物经反应得到, 其中, 多元胺组合物包含一种和/或多种二元胺和/或三元胺和/或三元以上的多元胺, 多元胺组合物的平均分子量介于 200 ~ 400 之间, 多元胺组合物的平均官能度大于 2 且不超过 2.20, 多元胺组合物中二元胺与三元胺分别占多元胺组合物总量的比例介于 77% ~ 96%: 3% ~ 12% 之间。抛光垫具有高可控性、较低的加工条件要求以及较宽的加工窗口, 所形成的抛光层具有较高的寿命稳定性。还提供了一种多元胺组合物、一种抛光层。

WO 2024/036983 A1

[见续页]

BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。